

化学

無機化学

注

(1) サブクラス C01B-C01G においては、ラストプレイス優先ルールが適用される、すなわち各階層レベルにおいて相反する指示のない限り、化合物は最後の適切な箇所に分類する、例. 過マンガン酸カリウムは、サブクラス C01G に過マンガン酸塩としてのみ分類する[3]

(2) 化合物または組成物の殺生物、有害生物忌避、有害生物誘引または植物生長調節活性は、さらにサブクラス A01P に分類する。[8]

非金属元素;その化合物 (発酵によるかまたは酵素を使用した元素または二酸化炭素以外の無機化合物の製造 C12P3/00;電気分解または電気泳動による非金属元素または無機化合物の製造 C25B)

注

(1) このサブクラスでは、グループの範囲を正確に定義するため科学文献および特許文献でしばしば使われる商品名が使用されている。[6]

(2) C セクションのタイトルに続く化学元素のグループの定義に注意すること[3]

(3) サブクラス C01B から C01G に適用するラストプレイス優先ルールを規定するクラス C01 に続くクラス注 (1) に注意すること。[8]

(4) 化合物の治療活性は、サブクラス A61P にさらに分類する。[7]

サブクラス内の索引

水素;水素同位元素;水;水素化合物
C01B3/00;C01B4/00;C01B5/00;C01B6/00
合成ガス C01B3/00.....
ハロゲン,その化合物 C01B7/00,C01B9/00,C01B11/00
酸素,酸化物一般;過化合物 C01B13/00;C01B15/00
いおう,その化合物 C01B17/00
窒素,その化合物 C01B21/00
りん,その化合物 C01B25/00
炭素,その化合物 C01B32/00
けい素,その化合物 C01B33/00
セレンまたはテルル;ほう素 C01B19/00;C01B35/00
希ガス C01B23/00.....
分子ふるい特性を有するが塩基交換特性を有しない化合物
C01B37/00.....
分子ふるい特性と塩基交換特性を有する化合物 C01B39/00..

水素;水素化合物;水;炭化水素からの合成ガス

3/00 水素;水素を含有する混合ガス;水素を含有する混合物からのその分離;水素の精

製(固体炭素質物質からの水性ガスまたは合成ガスの製造 C10J) [3]

A 水素貯蔵材料の使用

B ・材料に特徴のあるもの

Z その他のもの

3/02 ・水素または水素含有混合ガスの製造[3]

A 熱化学的反応サイクルによるもの

B ・水の熱化学的分解

D ・・ハロゲン化水素の分解による水素生成工程を含むもの

F ・・水素を含む無機化合物の還元による水素生成工程を含むもの

H ・・電気分解による水素生成工程を含むもの

Z その他のもの

3/04 ・・無機化合物,例.アンモニア,の分解によるもの[3]

R 水の分解によるもの

A ・光分解によるもの

B アンモニアの分解によるもの

C ハロゲン化水素の分解によるもの

Z その他のもの

3/06 ・・エレクトロポジティブに結合した水素を含有する無機化合物,例.水,酸,塩基,アンモニア,と無機還元剤との反応によるもの(水電解によるもの C25B1/04) [3]

3/08 ・・・金属によるもの[3]

A アルカリ金属によるもの

B アルカリ土類金属によるもの

Z その他のもの

3/10 ・・・金属と水蒸気との反応によるもの[3]

3/12 ・・・一酸化炭素と水蒸気との反応によるもの[3]

3/14 ・・・熱および蒸気の運用[3]

3/16 ・・・触媒を使用するもの[3]

3/18 ・・・移動固体粒子を使用するもの[3]

3/20 ・・・金属水酸化物と一酸化炭素との反応によるもの[3]

3/22 ・・気体または液体有機化合物の分解によるもの[3]

A アルコールの分解によるもの

Z その他のもの

3/24 ・・・炭化水素の[3]

3/26 ・・・触媒を使用するもの[3]

3/28 ・・・移動固体粒子を使用するもの[3]

3/30 ・・・流動床技術を用いるもの[3]

3/32 ・・ガス化剤,例.水,二酸化炭素,空気,と気体または液体有機化合物との反応によるもの[3]

A ガス化剤とアルコールとの反応によるもの

Z その他のもの

3/34 ・・・ガス化剤と炭化水素との反応による

	もの[3]
3/36	・ ・ ・ ・ ガス化剤として酸素または酸素含有混合物を用いるもの[3]
3/38	・ ・ ・ ・ 触媒を用いるもの[3]
3/40	・ ・ ・ ・ ・ 触媒を特徴とするもの[3]
3/42	・ ・ ・ ・ ・ 移動固体粒子を用いるもの[3]
3/44	・ ・ ・ ・ ・ 流動床技術を用いるもの[3]
3/46	・ ・ ・ ・ 不連続的に予熱された非移動固体材料を用いるもの, 例. プラストとラン[3]
3/48	・ ・ ・ ・ 一酸化炭素と水蒸気との反応にしたがうもの[3]
3/50	・ 混合ガスからの水素または水素含有ガスの分離, 例. 精製 (C01B3/14 が優先) [3]
3/52	・ 液体との接触によるもの; 使用液体の再生[3]
3/54	・ ・ ・ 触媒反応を含むもの[3]
3/56	・ 固体との接触によるもの; 使用固体の再生[3]
A	水素貯蔵材料を用いるもの
Z	その他のもの
3/58	・ ・ ・ 触媒反応を含むもの[3]
4/00	水素同位元素; 同位元素交換により製造されるその無機化合物, 例. $\text{NH}_3 + \text{D}_2 \rightarrow \text{NH}_2\text{D} + \text{HD}$ [2006. 01]
C	同位体交換反応を含むもの
D	・ 触媒を特徴とするもの
Z	その他のもの
5/00	水
A	水素と酸素の反応による水の生成
D	・ 触媒の組成・処理・再生
Z	その他のもの
5/02	・ 重水; 水素同位元素またはその化合物の化学反応による製造, 例. $4\text{ND}_3 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO}_2 + 6\text{D}_2\text{O}$, $2\text{D}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{D}_2\text{O}$
B	化学反応による重水の製造
D	同位体交換による重水の製造
E	・ 同位体交換反応触媒を特徴とするもの
Z	その他のもの
6/00	金属の水素化物; モノボランまたはジボラン; その付加錯化合物[2]
A	水素貯蔵に関するもの
Z	その他のもの
6/02	・ 遷移元素の水素化物; その付加錯化合物
6/04	・ アルカリ金属, アルカリ土類金属, ベリリウムまたはマグネシウムの水素化物; それらの付加錯化合物
6/06	・ アルミニウム, ガリウム, インジウム, タリウム, ゲルマニウム, 錫, 鉛, ひ素, アンチモン, ビスマスまたはポロニウムの水素化物; モノボラン; ジボラン; それらの付加錯化合物
6/10	・ ・ ・ モノボラン; ジボラン; それらの付加錯

	化合物[2]
6/11	・ ・ ・ ほう素またはほう素と酸素を含有する無機化合物からの製造[2]
6/13	・ ・ ・ モノボランまたはジボランの付加錯化合物, 例. ホスフィン, アルシンまたはヒドラジンとの[2]
6/15	・ ・ ・ ・ 金属ほう素水素化物; その付加錯化合物[2]
6/17	・ ・ ・ ・ ・ ほう素またはほう素と酸素とを含有する無機化合物からの製造[2]
6/19	・ ・ ・ ・ ・ 他のほう素化合物からの製造[2]
6/21	・ ・ ・ ・ ・ アルカリ金属, アルカリ土類金属, マグネシウムまたはベリリウムのほう素水素化物の製造; それらの付加錯化合物, 例. $\text{LiBH}_4 \cdot 2\text{N}_2\text{H}_4$, NaB_2H_7 [2]
6/23	・ ・ ・ ・ ・ 他の金属ほう素水素化物の製造, 例. ほう素化アルミニウム; その付加錯化合物, 例. $\text{Li} [\text{Al} (\text{BH}_4)_3\text{H}]$ [2]
6/24	・ 少なくとも 2 種の金属を含む水素化物, 例. $\text{Li} (\text{AlH}_4)$; その付加錯化合物 (C01B6/13-C01B6/23 が優先) [2]
6/26	・ 最高イオン価を有する金属またはその酸化物またはそのオキソ酸の塩からの製造
6/34	・ 精製; 安定化

ハロゲン; その化合物

7/00	ハロゲン; ハロゲン化水素酸
A	ハロゲン化水素
Z	その他のもの
7/01	・ 塩素; 塩化水素[2]
A	塩素
C	・ 水化〔和〕物
D	・ 分離
B	塩化水素
E	・ 塩素からの調製
F	・ ・ 塩素と水素からのもの
G	・ 有機塩素化合物からの調製
H	・ 分離
J	・ ・ 塩化水素を抽出することによるもの
K	・ ・ 塩化水素ガスを得るもの
L	・ ・ 塩酸及び金属塩化物を含有する廃液からの回収〔金属質材料の酸洗い廃液の再生 C23G1/36〕
Z	その他のもの
7/03	・ ・ 塩化物からの製造[2, 3]
A	塩素
B	塩化水素
C	・ 加水分解によるもの
Z	その他のもの
7/04	・ ・ ・ 塩化水素からの塩素の製造[3]

C 0 1 B

A	O ₂ での酸化によるもの
Z	その他のもの
7/05	・ ・ ・ 塩化アンモニウムからの製造[2, 3]
A	塩素
Z	その他のもの
7/07	・ ・ 精製[2, 3]
A	塩素
B	塩化水素
Z	その他のもの
7/075	・ ・ ・ 液体塩素の[2, 3]
7/09	・ 臭素; 臭化水素[2]
A	臭素
C	・ 分離; 精製
B	臭化水素
Z	その他のもの
7/13	・ よう素; よう化水素[2]
7/14	・ ・ よう素[2]
A	HI からの調製
B	電気分解プロセスを含むプロセス; 電気分解生成物を用いるプロセス [よう素の電解製造 C25B1/24]
C	分離; 精製
Z	その他のもの
7/16	・ ・ ・ 海草からの製造[2]
7/19	・ ふっ素; ふっ化水素[2]
A	ふっ化水素
B	・ 蛍石からの調製
C	・ 分離; 精製
D	・ ・ ふっ化水素を抽出することによるもの
Z	その他のもの
7/20	・ ・ ふっ素[2]
7/24	・ ハロゲン間化合物
9/00	ハロゲン化合物製造の一般的方法 (個々のハロゲン化合物は, ハロゲンと結合している元素にしたがって C01B-C01G の該当するグループ参照, 無機化合物の電解製造 C25B)
9/02	・ 塩化物
9/04	・ 臭化物
9/06	・ よう化物
9/08	・ ふっ化物
11/00	ハロゲンの酸化物またはオキシ酸; その塩
11/02	・ 塩素の酸化物
A	二酸化塩素
B	・ 塩素酸塩からの調製
C	・ ・ 還元剤として Cl ⁻ を用いるもの
D	・ ・ 還元剤として SO ₂ を用いるもの
E	・ ・ 触媒を用いるもの
F	・ 亜塩素酸塩からの調製
G	・ 分離; 精製
Z	その他のもの
11/04	・ 次亜塩素酸
11/06	・ ・ 次亜塩素酸塩, 例. 塩素化石灰

A	アルカリ金属次亜塩素酸塩
B	次亜塩素酸カルシウム
C	・ 調製
D	・ ・ 晒粉の
E	・ 晒液
F	次亜塩素酸マグネシウム
Z	その他のもの
11/08	・ 亜塩素酸
11/10	・ ・ 亜塩素酸塩
11/12	・ 塩素酸
11/14	・ ・ 塩素酸塩
11/16	・ 過塩素酸
11/18	・ ・ 過塩素酸塩
11/20	・ 臭素の酸素化合物
11/22	・ よう素の酸素化合物
11/24	・ ふっ素の酸素化合物

酸素; 酸化物または水酸化物一般; 過化合物

13/00	酸素; オゾン; 酸化物または水酸化物一般
13/02	・ 酸素の製造 (液化によるもの F25J)
A	吸着によるもの
B	化学反応によるもの
Z	その他のもの
13/08	・ ・ 金属酸化物, 例. 酸化バリウム, 酸化マンガンの助けにより空気から製造するもの
13/10	・ オゾンの製造
A	吸脱着式のもの
B	原料空気の除湿に特徴を有するもの
C	酸素リサイクル方式
D	オゾンの利用に特徴を有するもの
Z	その他のもの
13/11	・ ・ 放電によるもの[2]
A	放電装置に特徴を有するもの
B	・ 放電管
C	・ ・ 円筒型
D	・ ・ ・ 単管式
E	・ ・ ・ 多管式
F	・ ・ 平板型
G	・ 電極のみに特徴を有するもの
H	電気回路に特徴を有するもの
J	材質に特徴を有するもの
K	オゾン発生量の制御; プロセス制御
L	供給原料に特徴を有するもの [←原料の除湿]
M	冷却
Z	その他のもの
13/14	・ 酸化物または水酸化物の一般的製造方法 (特に個々の酸化物または水酸化物は酸素または水酸基と結合する元素にしたがって C01B-C01G または C25B の該当するグループ参照)

	ループを参照)		の
A	表面処理・改質	Z	その他のもの
B	造粒	15/04	・金属過酸化化物またはその過酸化水素化物; 超酸化化物;オゾニド[3]
Z	その他のもの〔←真空蒸着, スパッタリング による薄膜の製造〕	15/043	・・アルカリ金属, アルカリ土類金属のまたは マグネシウムの[2, 3]
13/16	・・精製[3]	15/047	・・重金属の[2, 3]
13/18	・・化合物の, 例. 塩または水酸化物の, 熱分 解[3]	15/055	・過酸化水素化物 (C01B15/04 が優先) ;ペ ルオキシ酸またはその塩[3]
13/20	・・ガス状態にある元素の酸化によるもの; ガス状態にある化合物の酸化または加水 分解によるもの[3]	15/06	・・いおうを含むもの[3]
13/22	・・・ハロゲン化物またはオキシハロゲン 化物の[3]	15/08	・・・ペルオキシ硫酸塩[3]
13/24	・・・・燃焼熱ガスの存在における[3]	15/10	・・炭素を含むもの[3]
13/26	・・・・流動床の存在における[3]	A	製造
13/28	・・・・プラズマまたは放電を用いるもの [3]	B	・液相より晶出させるもの
13/30	・・・・酸化物を含む懸濁物の除去と冷却 [3]	G	・・液相中に有機化合物を存在させるもの
13/32	・・液体または固体の状態にある元素また は化合物の酸化または加水分解によるも の[3]	M	処理
13/34	・・霧化または噴霧された溶液の酸化また は加水分解によるもの[3]	Q	・有機化合物を含む添加剤による安定化〔製 造工程中の安定剤の添加→A-G〕
13/36	・・溶液中の沈でん反応によるもの[3]	Z	その他のもの
15/00	過酸化化物;過酸化水素化物;ペルオキシ酸ま たはその塩;超酸化化物;オゾニド	15/12	・・ほう素を含むもの[3]
15/01	・過酸化水素[3]	15/14	・・けい素を含むもの[3]
15/013	・・分離;精製;濃縮[3]	15/16	・・りんを含むもの[3]
15/017	・・・無水過酸化水素;過酸化水素を含む無 水溶液またはガス状混合物[3]		
15/022	・・有機化合物からの製造[2]		
15/023	・・・アルキル—アントラキノン法による もの[3]	17/00	いおう;その化合物
A	還元工程	C	粒, 小片, その他成型品の製造〔コロイド状 いおうまたは粉状いおう→17/10〕
G	酸化・抽出工程	D	・液状いおうと小滴に分割し, 固化すること によるもの
T	劣化作動液の再生工程	Z	その他のもの
Z	その他のもの〔←溶媒の組成〕	17/02	・いおうの製造;精製
15/024	・・・炭化水素からのもの[3]	17/027	・・元素状いおうを含む原料, 例. ルックス マス, からのいおうの回収;精製[3]
15/026	・・・アルコールからのもの[3]	A	気化によるもの
15/027	・・水からの製造[3]	E	・物質を添加するもの
15/029	・・水素および酸素からの製造[3]	M	溶融によるもの
15/03	・・無機過酸化化合物からの, 例. ペルオキ シ硫酸塩からの, 製造[3]	R	・物質を添加するもの〔水, 水蒸気, 不活性 ガスは除く〕
15/032	・・・金属の過酸化化物からの製造[3]	Z	その他のもの
15/037	・・添加剤による安定化[3]	17/033	・・・液体抽出剤を用いるもの[3]
A	有機化合物を含む添加剤によるもの	17/04	・・ガス状硫化物を含むガス状いおう化合 物からのもの
C	・含いおう有機化合物を含む添加剤による もの〔窒素も含むもの→E, りんも含むも の→G〕	A	SO _x を含むガスからのもの〔N 含有化合物も 含むガスからのもの, →X〕
E	・含窒素有機化合物を含む添加剤によるも の〔りんも含むもの→G〕	C	・SO _x と気体, 液体還元剤との反応を含むも の〔気体還元剤が H ₂ S→M-V; クラウス法テ ールガスの処理→V; 湿式法 17/05〕
G	・含りん有機化合物を含む添加剤によるも	E	・SO _x と固体還元剤との反応を含むもの
		F	・・固体還元剤;その前後処理;その供給, 排出〔廃ガスの収, 脱着工程と結合したも の→K, L〕
		H	・・反応後のガスの処理〔廃ガスの収, 脱着

	工程と結合したもの→K, L]		再生
W	・ ・ ・ クラウス工程による処理 [←そのための還元工程の操作]	P	・ ・ 湿式法によるもの
K	・ ・ 廃ガスの収, 脱着工程と結合したもの [収着済収着剤より SO _x を放出せずいおうを回収するもの→E]	Z	その他のもの
L	・ ・ ・ 廃ガスの収, 脱着工程と還元工程とで炭素質物質が流用されるもの	17/18	・ ・ 水素多硫化物
M	H ₂ S を含むガスからのもの [N 含有化合物も含むガスからのもの→X]	17/20	・ 硫化物または多硫化物の一般的製造方法 (硫化または多硫化アンモニウム C01C; アルカリ金属, マグネシウム, カルシウム, ストロンチウムおよびバリウム以外の金属硫化物または多硫化物はその金属にしたがい C01F または C01G の該当するグループ参照)
N	・ H ₂ S と SO _x または O ₂ との反応を含むもの [H ₂ S が SO _x 還元により製造されたもの→A-L]	17/22	・ アルカリ金属硫化物または多硫化物
Q	・ ・ 無触媒燃焼反応工程	17/24	・ ・ 還元による製造
R	・ ・ 触媒反応工程	17/26	・ ・ ・ 炭素によるもの
T	・ ・ ・ いおうの露点以下で反応させるもの [←CBA 法] [いおうの露点は, 444.6°C]	17/28	・ ・ ・ 還元性ガスによるもの
V	・ ・ 反応後のガスの処理 [←SCOT 法; CBA 法→T]	17/30	・ ・ ナトリウムまたはカリウムアマルガムといおうまたは硫化物からの製造
X	N 含有化合物を含むガス状いおう化合物からのもの	17/32	・ ・ ナトリウムまたはカリウムの水硫化物
Z	その他のもの [←H ₂ S+H ₂ O ₂ →S+2H ₂ O]	17/34	・ ・ ナトリウムまたはカリウムの多硫化物
17/05	・ ・ ・ 湿式法によるもの [3]	17/36	・ ・ 精製
A	H ₂ S を含むガスと SO _x または O ₂ を含むガスからのもの [吸収溶液組成は最後の適切な箇所に分類する]	17/38	・ ・ 脱水
B	・ アルカリ金属, アルカリ土類金属, アンモニウム含有液中でのもの	17/40	・ ・ 成形品, 例. 粒, の製造
E	・ 重金属含有液中でのもの	17/42	・ マグネシウム, カルシウム, ストロンチウムまたはバリウムの硫化物または多硫化物
G	・ 有機化合物含有液中でのもの	17/43	・ ・ 酸化物または水酸化物といおうまたは硫化水素とからのもの
J	・ ・ 金属キレート化合物含有液中でのもの	17/44	・ ・ 硫酸塩の還元によるもの
L	・ ・ 芳香族ニトロ化合物含有液中でのもの	17/45	・ いおうとハロゲンとを含有し, 酸素を伴うまたは伴わない化合物
N	・ ・ キノン類含有液中でのもの	A	ハロゲン化いおう
Z	その他のもの	G	・ ふつ素を含むもの
17/06	・ ・ 非ガス状硫化物またはそのような硫化物を含む原料, 例. 鉱石, からのもの	Z	その他のもの
A	湿式法によるもの	17/46	・ いおう, ハロゲン, 水素および酸素を含有する化合物
B	・ SO _x 及びまたは, O ₂ を含むガスとからのもの	17/48	・ 二酸化いおう; 亜硫酸
Z	その他のもの	17/50	・ ・ 二酸化いおうの製造
17/10	・ ・ 粉状いおう, 例. 昇華いおう, いおう華	A	非ガス状いおう化合物からのもの [←H ₂ SO ₄ からのもの]
17/12	・ ・ 不溶性いおう (μ-いおう)	C	・ アンモニウムを含む非ガス状いおう化合物からのもの [←イミド硫酸からのもの; SO _x 脱硫液の SO ₂ を放つての再生→17/60B]
17/16	・ 硫化水素	E	・ 金属を含む非ガス状いおう化合物からのもの [硫化鉱の焙焼によるもの→17/52; SO _x 脱硫液の SO ₂ を放つての再生→17/60A-P]
A	乾式法による製造 [H ₂ S 吸収体の H ₂ S を放つての再生→N]	G	・ ・ 重金属を含む非ガス状いおう化合物からのもの
B	・ ガス状いおう化合物からのもの	M	ガス状いおう化合物からのもの
D	・ ・ SO _x を含むガスからのもの	N	・ SO ₃ からのもの [S+SO ₃ →Z]
F	湿式法による製造; 融液中における製造	Z	その他のもの
H	・ 水性媒体中におけるもの [←いおう分含有水溶液を噴霧するもの; H ₂ S 吸収液の H ₂ S を放つての再生→P]	17/52	・ ・ ・ 硫化物のばい焼によるもの (原鉱石
M	分離; 精製		
N	・ ガスからの硫化水素の収着および分離,		

	またはスクラップの予備的処理一般 C22B1/00) [2006. 01]		もの〔多段式 SO ₃ 転化の中間吸収→ 17/765A〕
A	流動焙焼法によるもの〔←渦動床〕	M	・他のガス処理工程, 例. 二酸化いおうま または空気の乾燥工程, とで水性媒体が流 用されるもの
Z	その他のもの	Z	その他のもの
17/54	・・・・元素状いおうの燃焼によるもの	17/76	・・・・接触法による
A	いおうを溶融させるもの	A	他のいおう, いおう化合物処理工程, 例. 二 酸化いおうの製造, 精製, 乾燥または三酸 化いおうの吸収工程, と結合したもの〔多 段式, SO ₃ 転化の中間吸収との結合→ 17/765A〕
Z	その他のもの	Z	その他のもの
17/56	・・・・分離; 精製	17/765	・・・・多段式 SO ₃ 転化[3]
A	洗浄による不純物の除去〔SO _x 含有焙焼ガ スの水洗, 酸洗による除塵, 冷却または脱 水〕	A	三酸化いおうの中間分離工程と結合したも の
E	・添加物を含む洗浄液によるもの	Z	その他のもの
Z	その他のもの	17/77	・・・・流動床法[3]
17/58	・・・・アシッドタールまたは同等物から二 酸化いおうの回収	17/775	・・・・液相接触法または湿式触媒法[3]
17/60	・・・・ガスから二酸化いおうの分離	A	液相接触法〔使用触媒を特徴とするもの→ 17/78, 79〕
A	湿式法によるもの	E	・炭素質触媒によるもの
B	・アルカリ金属, アルカリ土類金属またはア ンモニウム含有液によるもの	Z	その他のもの
G	・酸性物質〔例. 重亜硫酸塩〕の添加によ り SO ₂ を放出するもの	17/78	・・・・使用触媒を特徴とするもの
J	・いおう化合物の分離または分解により SO ₂ を放出するもの	17/79	・・・・バナジウムを含むもの[3]
M	・重金属含有液によるもの	17/80	・・・・装置
P	・有機化合物含有液によるもの	A	触媒転化器
Z	その他のもの	Z	その他のもの
17/62	・亜硫酸塩の一般的製造方法（特に個々の 亜硫酸塩は陽イオンにしたがい C01B-C01G 中の該当するグループ参照）	17/82	・・・・酸化窒素法を用いる硫酸の
17/64	・チオ硫酸塩; 亜二チオン酸塩; 多チオン酸 塩	17/84	・・・・鉛室法
B	ガス状酸化剤〔除 SO _x 〕を用いる製造	17/86	・・・・塔式法
Z	その他のもの	17/88	・硫酸の濃縮
17/66	・亜二チオン酸塩	A	加熱表面に硫酸を接触させるもの〔蒸発操 作が多段のもの→S〕
B	蟻曹法による製造〔HCOONa + NaHSO ₃ + SO ₂ → Na ₂ S ₂ O ₄ + CO ₂ + H ₂ O〕	B	・硫酸の薄層を接触させるもの
E	・亜二チオン酸塩結晶洗浄液または結晶分 離母液の処理	E	・循環させるもの〔薄層を接触させるもの →B〕
M	処理	H	加熱ガスと硫酸を直接接触させるもの〔蒸 発操作が多段のもの→S〕
Z	その他のもの	S	二以上の蒸発操作を結合したものの, 例. 多重 効用蒸発缶
17/69	・三酸化いおう; 硫酸[3]	Z	その他のもの
M	添加剤による処理〔←増粘; ←固体化〕	17/90	・・・・分離; 精製
Z	その他のもの〔SO ₃ の水性媒体への吸収によ る硫酸の製造→17/74G〕	A	温度, 圧力または濃度の調整; 攪拌; 蒸留; 脱 気によるもの〔H ₂ O, SO ₃ , 不活性ガスを除く のガスの吹き込み→K-R〕
17/70	・・・・γ型三酸化いおうの安定化	C	・液相より不純物を析出させるもの〔←液 相として析出〕
17/74	・・・・製造[3]	E	電解; 透析; 浸透; 逆浸透によるもの
A	三酸化いおうの製造〔触媒によるもの→ 17/76-17/80〕	K	H ₂ O, SO ₃ , H ₂ SO ₄ , 不活性ガスを除く物質の添 加によるもの
D	液相中での硫酸の製造〔←液相中での, SO ₃ ² -の不均化 (S + SO ₄ ²⁻)〕	L	・沈澱剤によるもの〔酸化による沈澱生成 →R; 吸着剤による沈澱生成→P〕
E	・酸化によるもの〔液相接触法→17/775A〕		
F	・・・・ハロゲン, ハロゲン化合物を用いるもの		
G	・三酸化いおうの水性媒体への吸収による		

P	・吸着剤によるもの	F25J)	
Q	・・イオン交換樹脂またはキレート樹脂によるもの	B	吸着によるもの
R	・酸化剤によるもの〔不活性ガスとしての空気の使用→A〕	D	・主に窒素と酸素とからなる混合物, 例. 空気, から酸素を吸着し除去するもの
S	・液体抽出剤によるもの	G	・主に窒素と酸素とからなる混合物, 例. 空気, から窒素を吸着し回収するもの
Z	その他のもの	K	・・窒素吸着剤
17/92	・・・アシッドタルまたは同等物からの回収	M	拡散によるもの
17/94	・・・ニトロ化用酸からの回収	N	・主に窒素と酸素とからなる混合物, 例. 空気, から酸素を拡散し除去するもの
17/96	・硫酸塩の一般的製造方法 (特に個々の硫酸塩は陽イオンにしたがい C01B-C01G 中の該当するグループ参照)	Q	磁気によるもの
17/98	・いおうと酸素を含有する他の化合物 (過硫酸 C01B15/06; 過硫酸塩 C01B15/08)	R	不純物を反応させ除去するもの〔吸着→B-K〕
19/00	セレン; テルル; それらの化合物	S	・水素または炭素を含む物質と反応させるもの〔液相中→W〕
A	酸素を含むもの	T	・・水素と反応させるもの
C	・セレンと酸素を含むもの	V	・金属と反応させるもの〔←メルト金属中〕
E	・テルルと酸素を含むもの	W	・液相中で反応させるもの〔メルト金属中→V〕
F	・・重金属をさらに含むもの	Z	その他のもの〔空気からの不活性ガスの製造方法→B01J19/14, 同製造装置→B01J7/00〕
G	いおうを含むもの	21/06	・窒素と金属, けい素またはほう素とからなる二元化合物
K	・テルルといおうを含むもの	A	窒素と特定金属との二元化合物〔B, D, F, 21/064, 21/068, 21/072 または 21/076 にまたがる製造方法→M-Z〕
M	ハロゲンを含むもの	B	・窒素とアルカリ金属との二元化合物
Z	その他のもの	D	・窒素と鉄族との二元化合物
19/02	・元素状セレンまたはテルル[3]	F	・窒素とアクチニドとの二元化合物
B	元素状セレンの製造	M	窒素と金属, けい素またはほう素とからなる二元化合物の一般的製造方法
E	・液相中での還元によるもの	N	・金属, けい素またはほう素元素からのもの
G	元素状セレンの処理	R	・金属, けい素またはほう素と酸素との結合を含む化合物からのもの
J	・基体からセレン薄膜を分離するもの	Z	その他のもの
Z	その他のもの	21/064	・・ほう素との化合物[3]
19/04	・二元化合物[3]	B	製造
A	金属のセレン化物; 金属のテルル化物〔←金属の一部を他の金属に置換したもの; ←Se の一部を Te に置換したもの〕	D	・ほう素元素からのもの
W	・Zn, Cd, Hg の〔セレン化物→C; テルル化物→G〕	G	・ほう素と酸素との結合を含む化合物からのもの
B	・金属のセレン化物	H	・・反応系に含窒素有機化合物を添加するもの
C	・・Zn, Cd, Hg の	J	・ほう素の水素, ハロゲンもしくはアルキル化合物またはほう素と窒素との結合を含む化合物, 例. ボラゾール, ボラジン, からのもの
G	・金属のテルル化物	M	処理〔超高压を用いる相転移→B01J3/06〕
H	・・Zn, Cd, Hg の	Z	その他のもの
M	セレンとテルルとからなるもの〔金属も含むものA〕	21/068	・・けい素との化合物[3]
Z	その他のもの	C	製造
21/00	窒素; その化合物	D	・けい素元素からのもの
21/02	・窒素の製造 (アンモニアの分解による C01B3/04)	E	・・反応系に金属成分を添加するもの〔運
A	窒素と水素との化合物からのもの〔水素混合ガスの製造→3/04; 廃ガス中の窒素酸化物のアンモニアによる還元によるもの→B01D53/34, 36〕		
Z	その他のもの〔廃ガス中の窒素化合物からのもの→B01D53/34, 36〕		
21/04	・窒素の精製または分離 (液化によるもの		

	動状態で反応させるもの→F]		含む化合物 [←アルコキシド] からのもの
F	・運動状態, 例. 移動状態, で反応させるもの	Z	その他のもの
G	・けい素と酸素との結合を含む化合物からのもの	21/08	・アジ化水素;アジド;ハロゲン化アジド
W	・・けい素と酸素との結合を含む化合物[例. アルコキシド] と炭素源物質とを混合し窒化するもの [運動状態で反応させるもの→K]	21/082	・窒素と非金属とを含む化合物 (C01B21/06, C01B21/08 が優先) [3]
H	・・・シリカ粉と炭素質粉とを混合し窒化するもの	C	1 またはそれ以上のけい素原子を含むもの [21/083-096 に優先する] [←無機シラザン, 窒化けい素鉄]
J	・・・・反応系に金属成分を添加するもの	D	・1 またはそれ以上の酸素原子をさらに含むもの [←酸窒化けい素]
K	・運動状態, 例. 移動状態, で反応させるもの	E	・・1 またはそれ以上のアルミニウム原子をさらに含むもの
M	・けい素の水素, ハロゲンもしくはアルキル化合物または該化合物の窒化生成物, シリコンイミド, シリコンジイミドからのもの [けい素元素を経るもの→D; けい素と酸素との結合を含む化合物を経るもの→G; ポリシラザンを経るもの→Q]	F	・・・けい素元素からの製造
N	・電気もしくは波動エネルギーの直接適用または粒子線放射を用いるもの [膜状物の製造→Y]	G	・・・けい素と酸素との結合を含む化合物からの製造
Y	・膜状物の製造	J	・・・けい素と窒素との結合を含む化合物からの製造
P	・窒化生成物またはシリコンイミド, シリコンジイミドからのもの	K	1 またはそれ以上の炭素原子を含むもの [21/083-096 に優先する]
Q	・ポリシラザンからのもの	L	・1 またはそれ以上のけい素原子をさらに含むもの
R	処理 [P が優先]	Z	その他のもの [酸窒化金属は金属に従い分類する]
S	・エツチング	21/083	・・1 またはそれ以上のハロゲン原子を含むもの[3]
T	・精製;分離	21/084	・・・1 またはそれ以上の酸素原子をさらに含むもの, 例. ハロゲン化ニトロシル [3]
U	・添加剤による表面の改質	21/086	・・1 またはそれ以上のいおう原子を含むもの[3]
Z	その他のもの	21/087	・・1 またはそれ以上の水素原子を含むもの[3]
21/072	・アルミニウムとの化合物[3]	21/088	・・・1 またはそれ以上のハロゲン原子をさらに含むもの[3]
A	製造	21/09	・・・・ハロゲンアミン, 例. クロラミン[3]
B	・金属アルミニウムからのもの	21/092	・・・1 またはそれ以上の金属原子をさらに含むもの[3]
F	・運動状態 [ガス状も含む] で反応させるもの	21/093	・・・1 またはそれ以上のいおう原子をさらに含むもの[3]
G	・アルミニウムと酸素との結合を含む化合物 [←アルコキシド], または反応時該化合物となるアルミニウム化合物, 例. 硝酸アルミニウム, からのもの	A	窒素酸化物からの製造
J	・反応系に金属 [除, アルミニウム] またはけい素成分を添加するもの	Z	その他のもの
M	・アルミニウムの水素, ハロゲンもしくはアルキル化合物または該化合物の窒化生成物からのもの	21/094	・・・・酸基を含むニトロシル[3]
R	処理	21/096	・・・・アミド硫酸;その塩[3]
Z	その他のもの	A	窒素酸化物からの製造
21/076	・チタンまたはジルコニウムとの化合物 [3]	Z	その他のもの
B	金属チタンまたは金属ジルコニウムからのもの	21/097	・りん原子を含むもの[3]
G	チタンまたはジルコニウムと酸素の結合を	21/098	・・窒化二ハロゲン化りん;その重合体[3]
		M	窒化二ハロゲン化リンの重合体 [オリゴマー→Z]
		Z	その他のもの
		21/12	・カルバミン酸;その塩
		21/14	・ヒドロキシルアミン;その塩

B	窒素と酸素を含む無機化合物の接触的還元による製造				気によるもの〔H ₂ O, NO _x , HNO ₃ または不活性ガス以外の物質の添加によるもの→S, Z〕
E	窒素を含む有機化合物からの製造				
Z	その他のもの		E	電解;透析;電気透析;逆浸透によるもの	
21/16	・ ・ ヒドラジン;その塩		S	液体抽出剤によるもの	
B	ヒドラジン・カルボニル化合物, 例. ヒドラゾン〔RR′ C=NNH ₂ 〕, イソヒドラゾンまたはアジン〔RR′ C=NN=CRR′ 〕, を経るもの		Z	その他のもの	
		21/48		・ ・ 硝酸塩の一般的製造方法 (特に個々の硝酸塩は陽イオンにしたがい C01B-C01G 中の該当するグループ参照)	
G	電気または波動エネルギーの直接適用または粒子線放射によるもの	21/50		・ ・ 亜硝酸;その塩	
Z	その他のもの	A		亜硝酸アンモニウム	
21/20	・ 窒素酸化物;窒素のオキシ酸;その塩	B		・ 窒素酸化物の吸収による製造	
21/22	・ ・ 亜酸化窒素 (N ₂ O)	E		アルカリ金属亜硝酸塩	
21/24	・ ・ 酸化窒素 (NO)	F		・ 窒素酸化物の吸収による製造	
A	他の窒素酸化物からの製造	J		マグネシウム, カルシウム, ストロニウムまたはバリウムの亜硝酸塩	
E	窒素の酸素酸またはその塩からの製造			またはバリウムの亜硝酸塩	
Z	その他のもの	K		・ 窒素酸化物の吸収による製造	
21/26	・ ・ ・ アンモニアの接触的酸化による製造	Z		その他のもの	
B	使用触媒を特徴とするもの	23/00		希ガス;その化合物 (液化 F25J)	
E	・ 貴金属を含む触媒	A		ヘリウム;ネオン	
H	触媒の劣化または損失の防止;損失触媒の回収	C		・ 吸着による分離または精製	
Z	その他のもの	E		・ 拡散による分離または精製	
21/28	・ ・ ・ ・ 装置	F		・ 不純物を反応させ除去する分離または精製	
21/30	・ ・ ・ 窒素の酸化による製造	G		アルゴン	
21/32	・ ・ ・ ・ 装置	H		・ 吸着による分離または精製	
21/34	・ ・ 三酸化窒素 (N ₂ O ₃)	J		・ ・ 前処理または後処理と結合したもの	
21/36	・ ・ 二酸化窒素 (NO ₂ , N ₂ O ₄) (C01B21/26, C01B21/30 が優先)	K		・ 拡散による分離または精製	
A	他の窒素酸化物からの製造	L		・ 不純物を反応させ除去する分離または精製	
C	・ 酸素酸化によるもの〔オゾンも用いるもの→E;電気もしくは波動エネルギーの直接適用または粒子線放射を用いるもの→G〕	M		クリプトン;キセノン	
D	・ ・ 触媒を用いるもの	P		・ 吸着による分離または精製	
E	・ オゾン酸化によるもの	Q		・ ・ 前処理または後処理と結合したもの	
F	・ ハロゲンまたはハロゲン化合物による酸化によるもの	S		ラドン	
G	・ 電気もしくは波動エネルギーの直接適用または粒子線放射を用いるもの	Z		その他のもの	
Z	その他のもの	25/00		りん;その化合物 (C01B21/00, C01B23/00 が優先;過りん酸塩 C01B15/16) [3]	
21/38	・ ・ 硝酸	A		添加剤による赤りんの改質, 例. 安定化	
21/40	・ ・ ・ 窒素酸化物の吸収による製造	Z		その他のもの	
B	吸収系に H ₂ O, NO _x , HNO ₃ を除く物質を存在させるもの	25/01		・ りんまたはりん化合物を得るためのりん酸塩鉱石または他のりん酸塩原料の処理 [2]	
E	アンモニアの接触的酸化工程と結合するもの	25/02		・ りんの製造	
Z	その他のもの	A		りん化合物からの製造	
21/42	・ ・ ・ 硝酸塩からの製造	C		りんと酸素との結合を含む化合物, 例. りん鉱, からの製造	
21/44	・ ・ ・ 濃縮	M		ある態種から他態種への転化によるもの, 例. 黄りんからの赤りん製造	
21/46	・ ・ ・ 精製;分離	Z		その他のもの	
A	温度, 圧力または濃度の調整;攪拌;蒸留;脱	25/023		・ ・ 赤りんの [2]	
		25/027		・ ・ 黄りんの [2]	
		25/04		・ りんの精製	
		25/043		・ ・ 赤りんの [2]	

25/047	・黄りんの[2]		
25/06	・りん化水素	F	・抽残〔ラファイネート〕の処理〔りん酸根を抽出するもの→C, G〕
25/08	・その他のりん化物	G	・溶媒・りん酸・水抽出相に物質を添加又は接触させるもの〔溶媒の剥離のためのもの→C〕
A	ほう素, アルミニウム, ガリウム, インジウムまたはタリウムのりん化物	K	・抽出精製されたりん酸の後処理
E	りん元素からの製造	Z	その他のもの
F	・ガス状りん元素からのもの	25/235	・・・・浄化; 溶解不純物の後沈 (Postprecipitation) を防止するための安定化[3]
G	りと酸素との結合を含む化合物からのもの	25/237	・・・・不純物の選択的除去[3]
Z	その他のもの	25/238	・・・・陽イオン不純物[3]
25/10	・りんのハロゲン化物またはオキシハロゲン化物[2]	A	陽イオン不純物の有機溶媒抽出工程を含むりん酸の精製
25/12	・りんの酸化物	Z	その他のもの
25/14	・りんのいおう, セレンまたはテルル化合物	25/24	・・縮合りん酸
25/16	・りんのオキシ酸; その塩 (ペルオキシ酸またはその塩 C01B15/00)	25/26	・・りん酸塩 (過りん酸塩 C01B15/16)
25/163	・・亜りん酸; その塩[2]	25/28	・・・・りん酸アンモニウム
25/165	・・次亜りん酸; その塩[2]	C	りん酸水溶液とアンモニアからの製造
25/168	・・ピロ亜りん酸; その塩[2]	D	・多段で中和するもの; 他のりん酸アンモニウム中間体が生成するもの
25/18	・・りん酸	F	・並流連続反応によるもの
25/20	・・・・元素状りんまたは無水りん酸からの製造	M	処理
25/22	・・・・りん酸塩含有原料を酸と反応させることによる製造, 例. 湿式法	Z	その他のもの
A	りん酸を含む酸によるもの〔硫酸をも含むもの→25/222〕	25/30	・・・・アルカリ金属りん酸塩
D	硝酸を含む酸によるもの〔←硫酸をも含むもの〕	B	りん酸水溶液とアルカリ金属化合物からの製造
Z	その他のもの	D	りん酸有機溶媒含有溶液とアルカリ金属化合物からの製造
25/222	・・・・硫酸, 主として硫酸より成る酸の混合物またはその場で硫酸を生成させる混合化合物, 例. 二酸化いおう, 水および酸素の混合物, によるもの[3]	M	処理
25/223	・・・・硫酸カルシウムのただ一つの形だけが生成されるもの[3]	Z	その他のもの
25/225	・・・・二水化物法[3]	25/32	・・・・マグネシウム, カルシウム, ストロントリウムまたはバリウムのりん酸塩
25/226	・・・・半水化物法[3]	B	カルシウムのりん酸塩
25/228	・・・・硫酸カルシウムの一形態が生成しついで他の形態に転化するもの[3]	C	・第一りん酸カルシウム $[\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2]$
25/229	・・・・半水化物—二水化物法[3]	G	・第二りん酸カルシウム $[\text{CaHPO}_4]$
25/231	・・・・二水化物—半水化物法[3]	K	・・無水塩
25/232	・・・・りん酸塩含有原料を濃硫酸と反応させひきつづき得られたものを浸出することによる製造, 例. クリンカー法[3]	M	・第三りん酸カルシウム $[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]$
25/234	・・・・精製; 安定化; 濃縮 (製造を伴う精製 C01B25/22; 液—液抽出を含む製造 C01B25/46) [3]	N	・・乾式法による製造
A	濃縮	P	・水酸基を含むもの
C	りん酸根の有機溶媒抽出工程を含むりん酸の精製 [C-K はラストプレースルールによらない; りん鉱石の有機溶媒抽出→25/46]	Q	・・製造
E	・りん酸の前精製〔りん酸根を抽出するもの→C, G〕	R	・・・・他のりん酸カルシウムからのもの
		V	・・・・有機物の存在下に製造するもの〔R に該当すれば R にも付与する〕
		W	・・処理
		Y	ストロントリウムまたはバリウムのりん酸塩
		Z	その他のもの
		25/34	・・・・りん酸マグネシウム
		25/36	・・・・りん酸アルミニウム
		D	有機物の存在下に製造するもの〔Q 優先〕
		Q	分子篩特性を有するもの
		Z	その他のもの

25/37	・・・重金属のりん酸塩[2]	32/168	・・・後処理[2017. 01]
H	チタン, ジルコニウムまたはハフニウムの りん酸塩	32/17	・・・精製[2017. 01]
J	・チタンの	32/172	・・・選別[2017. 01]
K	・ジルコニウムの	32/174	・・・誘導体化; 可溶化; 溶媒への分散 [2017. 01]
L	・・・有機物の存在下に製造するもの	32/176	・・・切断[2017. 01]
M	バナジウム, ニオブまたはタンタルのりん 酸塩	32/178	・・・開口; 充填[2017. 01]
Z	その他のもの	32/18	・ナノオニオン; ナノスクロール; ナノホ ーン; ナノコーン; ナノウォール [2017. 01]
25/38	・・・縮合りん酸塩	32/182	・グラフェン[2017. 01]
25/39	・・・アルカリ金属の[3]	32/184	・・・製造[2017. 01]
25/40	・・・ポリりん酸塩[2]	32/186	・・・化学蒸着[CVD]によるもの[2017. 01]
A	アンモニウムの	32/188	・・・エピタキシャル成長によるもの [2017. 01]
Z	その他のもの	32/19	・・・剥離によるもの[2017. 01]
25/41	・・・アルカリ金属の[3]	32/192	・・・黒鉛酸化物から出発するもの [2017. 01]
25/42	・・・ピロりん酸塩[2]	32/194	・・・後処理[2017. 01]
25/44	・・・メタりん酸塩[2]	32/196	・・・精製[2017. 01]
25/445	・・・アルカリ金属の[3]	32/198	・・・酸化グラフェン[2017. 01]
25/45	・・・複数の金属, または金属とアンモニウ ムを含むもの[3]	32/20	・黒鉛[2017. 01]
A	軽金属または軽金属とアンモニウムのみを 含むもの	32/205	・製造[2017. 01]
D	・ベリリウム, マグネシウム, カルシウム, ストロンチウムまたはバリウムを含むも の	32/21	・後処理[2017. 01]
G	・アルミニウムを含むもの	32/215	・・・精製; 製鉄において形成される黒鉛の 回収または精製, 例. キッシュ黒鉛 [2017. 01]
H	チタン, ジルコニウム, またはハフニウムを 含むもの	32/22	・・・層間化合物[2017. 01]
M	バナジウム, ニオブまたはタンタルを含む もの	32/225	・・・膨張; 剥離[2017. 01]
T	重金属とアルミニウムを含むもの	32/23	・・・酸化[2017. 01]
U	・分子篩特性を有するもの	32/25	・ダイヤモンド[2017. 01]
Z	その他のもの	32/26	・・・製造(超高压の使用によるもの B01J3/06; 結晶成長によるもの C30B29/04) [2017. 01]
25/455	・・・ハロゲンを含むもの[3]	32/28	・後処理, 例. 精製, 照射, 分離または回収 [2017. 01]
25/46	・・・液-液抽出を含む製造[2]	32/30	・活性炭[2017. 01]
32/00	炭素; その化合物 (C01B21/00, C01B23/00 が 優先; 過炭酸塩 C01B15/10; カーボンブラ ック C09C1/48) [2017. 01]	32/306	・分子ふるい特性を持ったもの[2017. 01]
32/05	・炭素の製造または精製でグループ C01B32/15, C01B32/20, C01B32/25, C01B32 /30 に包含されないもの[2017. 01]	32/312	・製造[2017. 01]
32/10	・ふっ化炭素, 例. [CF] _n または [C ₂ F] _n (そ の黒鉛層間化合物 C01B32/22) [2017. 01]	32/318	・・・出発物質に特徴のあるもの[2017. 01]
32/15	・ナノサイズの炭素物質[2017. 01]	32/324	・・・廃棄物, 例. タイヤまたは亜硫酸パ ルプ廃液, からのもの[2017. 01]
32/152	・フラーレン[2017. 01]	32/33	・・・石炭または石油の蒸留残渣からの もの; 石油酸スラッジからのもの [2017. 01]
32/154	・・・製造[2017. 01]	32/336	・・・ガス状活性化剤に特徴のあるもの [2017. 01]
32/156	・・・後処理[2017. 01]	32/342	・・・非ガス状活性化剤に特徴のあるもの [2017. 01]
32/158	・カーボンナノチューブ[2017. 01]	32/348	・・・金属化合物[2017. 01]
32/159	・・・シングルウォール[2017. 01]	32/354	・後処理[2017. 01]
32/16	・・・製造[2017. 01]	32/36	・・・再活性化または再生[2017. 01]
32/162	・・・触媒に特徴のあるもの[2017. 01]	32/366	・・・物理的处理によるもの, 例. 照射に
32/164	・・・連続プロセスを含むもの[2017. 01]		
32/166	・・・液相中[2017. 01]		

	よるもの, 炭素質フィードストックへの 通電によるものまたは再利用可能な不活 性加熱体の使用によるもの[2017. 01]	Z	その他のもの
32/372	・・・被覆; グラフト化; マイクロカプセル 化[2017. 01]	33/021	・・・製造 (気相からの化学的被覆 C23C16/00) [5]
32/378	・・・精製[2017. 01]	33/023	・・・シリカまたはシリカ含有材料の還元 によるもの[5]
32/384	・・・粒状化[2017. 01]	33/025	・・・炭素または固体炭素質材料による もの, すなわち炭熱法[5]
注 ・・・このグループにおいて粒状化という用語は炭素性前駆体 それ自体及び粘結剤, 例. ピッチ, を用いて活性炭を製造する方 法も包含する。[2017. 01]		33/027	・・・シリカまたはシリカ含有材料以外の 気体状または気化されたけい素化合物の 分解または還元によるもの[5]
32/39	・・・その製造のための装置[2017. 01]	33/029	・・・モノシランの分解によるもの[5]
32/40	・・・一酸化炭素[2017. 01]	33/03	・・・けい素ハロゲン化物またはハロシ ランの分解, または水素のみを還元剤と するその還元によるもの[5]
32/50	・・・二酸化炭素[2017. 01]	33/031	・・・四ヨウ化けい素の分解によるも の[5]
32/55	・・・固体化[2017. 01]	33/033	・・・金属または合金のみを還元剤とす る, けい素ハロゲン化物またはハロシラ ンの還元によるもの[5]
32/60	・・・炭酸塩または重炭酸塩の一般的製造方法 (過炭酸塩 C01B15/10; 特定の炭酸塩また は重炭酸塩はその陽イオンに従い C01B-C01G) [2017. 01]	33/035	・・・気体状または気化されたけい素化 合物の, けい素, 炭素, または耐火金属, 例. タンタルまたはタングステン, の加熱フ ィラメントの存在下における, もしくは 形成されるけい素が析出する加熱けい素 棒, すなわち得られるけい素の存在下 における, 例. シーメンス法, 分解または還 元によるもの[5]
32/70	・・・炭素およびいおうを含有する化合物, 例. チオフォスゲン[2017. 01]	33/037	・・・精製 (ゾーンメルテングによるもの C30B13/00) [5]
32/72	・・・二硫化炭素[2017. 01]	33/039	・・・けい素の化合物への転換, 選択的なそ の化合物の精製, 及びけい素への再転換 によるもの[5]
32/75	・・・いおうまたはいおう化合物と炭化水 素との反応による製造[2017. 01]	33/04	・・・けい素の水素化物
32/77	・・・炭素オキシ硫化物[2017. 01]	33/06	・・・金属けい化物
32/80	・・・フォスゲン[2017. 01]	33/08	・・・ハロゲンを含む化合物
32/90	・・・炭化物[2017. 01]	33/10	・・・けい素, ふっ素および他の元素を含有す る化合物
32/907	・・・オキシ炭化物; スルフォ炭化物; 炭化物 の混合物[2017. 01]	33/107	・・・ハロゲン化シラン[3]
32/914	・・・単一元素の炭化物[2017. 01]	A	ケイ素のフッ化物
32/921	・・・炭化チタン[2017. 01]	B	ケイ素のハロゲン化物の精製
32/928	・・・アクチニド炭化物[2017. 01]	Z	その他のもの
32/935	・・・アルカリ金属, ストロントウム, バリ ウムまたはマグネシウムの炭化物 [2017. 01]	33/113	・・・酸化けい素; その水和物[3]
32/942	・・・炭化カルシウム[2017. 01]	A	低級酸化物
32/949	・・・炭化タングステンまたは炭化モリブ デン[2017. 01]	Z	その他のもの
32/956	・・・炭化けい素[2017. 01]	33/12	・・・シリカ; その水和物, 例. うろこ状けい酸 [3]
32/963	・・・けい素を含む化合物からの製造 [2017. 01]	A	他元素含有シリカ
32/97	・・・SiO または SiO ₂ からの製造[2017. 01]	B	結晶質けい酸
32/977	・・・けい素を含む有機化合物からの 製造[2017. 01]	C	気相反応以外の方法による二酸化珪素薄膜 の形成
32/984	・・・けい素元素からの製造[2017. 01]	D	二酸化珪素の薄膜の後処理
32/991	・・・炭化ほう素[2017. 01]	E	溶融シリカの製法
33/00	けい素; その化合物 (C01B21/00, C01B23/00 が優先; 過けい酸塩 C01B15/14; 炭化けい 素 C01B32/956) [3]	Z	その他のもの
33/02	・・・けい素 (単結晶または特定構造を有する 均質多結晶材料の形成 C30B) [5]		
D	珪素被膜		
E	多結晶珪素		

33/14	・・・コロイド状シリカ, 例. ディスパー ジョン, ゲル, ゼル[3]		ガダイト型のアルカリ金属けい酸塩[6]
33/141	・・・ヒドロゾルまたは水性ディスパー ジョンの製造[3]	33/40	・・・粘土[6]
33/142	・・・けい酸塩の酸処理によるもの[3]	33/42	・・・雲母[6]
33/143	・・・けい酸塩の水溶液の[3]	33/44	・・・アンモニウム, ホスホニウムまたは スルホニウム化合物のような有機化合物 とのイオン交換により, または有機化合 物の挿入により層をなした塩基交換けい 酸塩から得られる生産物, 例. 有機粘土物 質[6]
33/145	・・・ヒドロオルガノゾル, オルガノゾル または有機媒体中のディスパージョンの 製造[3]	33/46	・・・無定型けい酸塩, 例. いわゆる “アモ ルファスゼオライト” [6]
33/146	・・・ゾルの後処理 (ヒドロゾルからの ヒドロオルガノゾル, オルガノゾルまた は有機媒体中のディスパージョンの製造 C01B33/145) [3]	35/00	ほう素; その化合物 (モノボラン, ジボラン, 金属ほう水素化物またはその付加錯化合 物 C01B6/00; 過ほう酸塩 C01B15/12; 窒素 との二元化合物 C01B21/06; りん化合物 C01B25/08; 炭化物 C01B32/991) [2]
33/148	・・・濃縮; 乾燥; 脱水; 安定化; 精製[3]	35/02	・ほう素; ほう化物[2]
33/149	・・・被覆[3]	35/04	・金属のほう化物[2]
33/151	・・・あるゾルを別のゾルに漸進的に 添加すること, すなわち「ヒール (heel)」 を用いる粒子の「形成」, によるもの[3]	A	遷移金属
33/152	・・・ヒドロゲルの製造[3]	B	・チタン
A	ゾルのゲル化によるもの	C	その他の金属
B	アルコキシドの分解によるもの	D	複数金属又は金属とアンモニウムとの組合 せ
Z	その他のもの	Z	その他
33/154	・・・けい酸塩水溶液の酸処理による もの[3]	35/06	・ほう素とハロゲンとの化合物[2]
33/155	・・・ヒドロオルガノゲルまたはオルガ ノゲルの製造[3]	35/08	・ほう素および窒素, りん, 酸素, いおう, セ レンまたはテルルを含む化合物[2]
33/157	・・・ゲルの後処理[3]	35/10	・ほう素および酸素を含む化合物 (C01B35/06 が優先) [2]
33/158	・・・精製; 乾燥; 脱水[3]	A	ほう酸
33/159	・・・被覆または疎水化[3]	Z	その他のもの
33/16	・・・シリカキセロゲルの製造[3]	35/12	・・・ほう酸塩[2]
33/18	・・・ゾル状でもゲル状でもない微粉状の シリカの製造; その後処理 (顔料性または 充てん剤の性質を改良するための処理 C09C) [3]	A	アルカリ金属塩
A	珪弗化物の分解によるもの	B	2A (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 金属塩
B	もみがらから珪酸の製造	C	その他の金属塩
C	シリカの被覆・疎水化	D	複数金属又は金属とアンモニウムとの組合 せ
D	シリカの精製・乾燥・脱水	Z	その他
E	その他の後処理	35/14	・ほう素および窒素, りん, いおう, セレン またはテルルを含む化合物[2]
Z	その他のもの	35/16	・ほう素の 2 原子間の直接結合を含む化合 物, 例. $\text{Cl}_2\text{B}-\text{BCl}_2$ [2]
33/187	・・・けい酸塩の酸処理によるもの[3]	35/18	・3 個以上のほう素原子を含む化合物, 例. NaB_3H_8 , $\text{MgB}_{10}\text{Br}_{10}$ (ボラゾール C01B35/14) [2]
33/193	・・・けい酸塩の水溶液の[3]		
33/20	・けい酸塩 (過けい酸塩 C01B15/14)		
33/22	・けい酸マグネシウム		
33/24	・アルカリ土類金属けい酸塩		
101	・・・けい酸カルシウム		
33/26	・アルミニウム含有けい酸塩[5]		
33/32	・アルカリ金属けい酸塩 (C01B33/26 が 優先) [3]		
33/36	・塩基交換特性を有するが分子ふるい特 性を有しないもの[6]		
33/38	・層をなした塩基交換けい酸塩, 例. 粘 土, 雲母, またはケニアイト型もしくはマ	37/00	分子ふるい特性を有するが塩基交換特性を 有しない化合物[6]
		37/02	・結晶性シリカ多形体, 例. シリカライト[6]

化学構造よりもむしろ物理的または化学的特性に
主として特徴のある化合物[6]

